

特許 & 技術レポート

特許 & 技術レポート

河 合同特許法律事務所/SEOUL TECHNO R&C CO., LTD.

2013-10

.....

ハイライト :

五大特許庁によるPPH開始	1
サムスン-LGディスプレイの特許紛争終結	2
LED照明用放熱印刷回路基板の特許増加	3
リチウム二次電子の特許動向	3
第一毛織、サムスンエバーランドにファッション事業を譲渡	4
サムスン電子、次世代CMOSイメージセンサのISOCELL開発	4



特許制度

五大特許庁によるPPH開始

韓国・日本・米国・中国・欧州の5か国(IP5)間の特許審査ハイウェイが開始される。来年1月より、韓国特許庁に特許を出願すると、IP5で特許出願の審査期間を短縮させることができる。韓国特許庁は9月24日、スイス・ジュネーブで開催された「第51回世界知的所有権機関(WIPO)」総会で、韓国・日本・米国・中国・欧州の5か国の特許庁長が、2014年1月より「IP5特許審査ハイウェイ(IP5-PPH)」を施行することに合意したことを明らかにした。

特許審査ハイウェイ(PPH)は、出願人が複数の国に特許出願した場合、最初の審査情報を他の国に提出し、一般出願より早く審査する制度。韓国特許庁に特許出願すると、先ず審査を行い、特許可能と判断された場合、書類をIP5で参考にして審査期間を短縮する方式である。

これまでは個別国同士で対一の方式により行われていた「二国間PPH」は、国毎にPPHの申請要件と提出書類が互いに異なっていた。よって、出願人が複数の国で特許を受けるのに都合が悪かった。今回の合意により、IP5間において簡素で標準化された要件が適用され、企業はPPHによって出願を希望する国で早期に特許権を確保することができる。

IP5-PPHには欧州特許庁(EPO)も参加した。欧州は、韓国が米国、中国に続いて三番目に特許を多く出願する地域である。昨年韓国のEPO出願件数は5711件であった。これまで韓国とEPOは別途PPHを締結していなかったため、早期特許の確保に困難があった。IP5の合意により、来年からはEU市場で韓国企業の特許権早期確保の道が開かれたわけだ。韓国特許庁は、「IP5は世界の特許出願件数の90%を占めており、このうち26%は2カ国以上重複出願されるものと推算される」とし、「IP5-PPHが施行されれば、IP5が抱えている特許審査の停滞問題を解消し、審査処理期間を短縮させることができるであろう」と期待している。

特許庁はIP5-PPHと別に、韓国企業の主要な出願国であるスウェーデン、スペイン、ポルトガル、イスラエルの特許庁と二国間PPH及び国際特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)の施行のための業務協約を締結する。韓国は19カ国とPPH、

PCT-PPHを締結し、企業が早く特許を受けることができる基盤が設けられる。キム・ヨンミン韓国特許庁長は、「産業財産権の出願世界4位、PCT出願世界5位等、知的財産分野で韓国の高い国際的地位に基づき、韓国国民と企業の持つ創造的アイデアが海外で広く保護・活用できるように知的財産基盤の創造経済を構築していくつもりである」と述べた。

国際特許審査ハイウェイ (PCT-PPH) = PCT国際出願の国際段階で特許可能の判断を受けた場合、国内段階で優先審査する制度。PCT (特許協力条約) とは、一つの出願で148の条約参加国に全て出願したのと同じ効果を有するように出願手続きを統一化した国際条約である。PCT-PPHは、PCT出願についても一定要件を満たす場合、PPHを適用するようにしたものである。



特許判例

大法院2013. 3. 14. 宣告2011HU1159判決[拒絶決定(商)審決取消の訴][公2013上、674]

【判示事項】

[1] 出願商標が商標法第7条第1項第11号後段の「需要者を欺瞞する恐れがある商標」に該当するとするためには、出願商標と対比される先使用商標の権利者は、出願人以外の他人でなければならないかどうか(積極)及び先使用商標の権利者が誰なのか判断する基準

[2] 特許庁審査官が「SODA」で構成された甲株式会社の商標出願について、出願商標が商標法第7条第1項第11号に該当するという理由で拒絶決定した事案において、出願商標は先使用商標の権利者により出願されたものであるため、商標法第7条第1項第11号の「需要者を欺瞞する恐れがある商標」に該当するといえないにもかかわらず、これと異にした原審判決に法理を誤解した違背があったとした事例。

【判決要旨】

[1] 商標登録を受けることができない商標を規定している商標法第7条第1項第11号後段の趣旨は、既に特定人の商標として認識されている先使用商標を使用する商品の出所等に関する一般需要者の誤認・混同を防止し、これに対する信頼を保護しようとするものであるため、ある出願商標が上記規定の「需要者を欺瞞する恐れがある商標」に該当するとするためには、出願商標と対比される先使用商標の権利者は出願人以外の他人でなければならない。ここで、先使用商標の権利者が誰なのかは先使用商標の選択と使用を取り巻く関連当事者間の具体的な内部関係等を総合的に見て判断しなければならない。先使用商標の使用者以外に使用許諾契約等を通じて先使用商標使用者の商標使用を統制したり、先使用商標

を使用する商品の性質や品質を管理してきた者が別にいる場合には、それを先使用商標の権利者と見なければならず、先使用商標の使用者を権利者と見ることはない。

[2] 特許庁審査官が指定商品を「腕時計」等とし、「SODA」で構成された甲株式会社の商標出願について、出願商標が指定商品のうち「時計類及び時計付属品」に使用される場合、甲会社と商標使用契約を締結し、先使用商標「SODA」を使用してきた乙株式会社により使用されていると誤認、混同を生じさせて、需要者を欺瞞する恐れがあり、商標法第7条第1項第11号に該当するという理由で拒絶決定した事案において、先使用商標の権利者は、先使用商標を選択し、商標使用契約を通じて乙会社の商標使用を統制し、先使用商標を使用する商品の性質や品質を管理する権限を有する甲会社であるといえ、先使用商標の使用者である乙会社を権利者と見ることはない。出願商標は先使用商標の権利者により出願されたものであり、よって、商標法第7条第1項第11号の「需要者を欺瞞する恐れがある商標」に該当するといえないにもかかわらず、先使用商標の使用者である乙会社を権利者と見て、出願商標が「需要者を欺瞞する恐れがある商標」に該当すると見た原審判決に法理を誤解した違法があったとした事例。

【参照条文】

[1] 商標法第7条第1項第11号 [2] 商標法第7条第1項第11号

【参照判例】

[1] 大法院1999. 12. 24. 宣告97HU3623判決(公2000上、309)

紛争

サムスン-LGディスプレイの特許紛争終結

サムスンディスプレイとLGディスプレイの特許訴訟が終結した。

サムスンディスプレイとLGディスプレイは9月23日、相互提起した液晶表示装置(LCD)と有機発光ダイオード(OLED)に関する特許訴訟及び特許無効審判を直ちに取下げ、両社間の対話を通じた特許協力案を模索することで合意したことを明らかにした。

両社は今回の合意を通じ、消耗的な特許紛争を止揚し、両社間の対話を通じた特許協力案に注力することとした。予想される協力モデルは、サムスン電子とSKハイニックス間の特許共有であって、サムスン電子とSKハイニックスは7月に半導体分野の特許を互いに使用できるようにする包括的な特

許共有契約を締結している。当時、サムスン電子とSKハイニックスが特許交渉を始めてから3年後の結論であり、サムスンディスプレイとLGディスプレイの特許協力案も相当の時間がかかるであろうと業界は見ている。

サムスンディスプレイとLGディスプレイの特許訴訟は、昨年9月に始まった。サムスンディスプレイがLGディスプレイを相手にOLED技術等に対する侵害差止仮処分を申請するやいなや、LGディスプレイはサムスン電子及びサムスンディスプレイを相手にOLED特許侵害差止及び損害賠償訴訟を提起し、応訴した。

サムスンディスプレイIP総括のキム・クァンジュン専務は、「今回の合意は両社が法的紛争を解消し、より建設的な方向で協力していくきっかけになるであろう」とし、「これを通じて両社がグローバル競争力を向上させ、ディスプレイ産業の発展に寄与できるであろう」と述べた。

LGディスプレイ技術戦略グループ長ソン・ヨンゴン常務は、「今はグローバルの観点で両社共に会社の特許競争力を高めることが最も重要な状況である」とし、「今後、対話を通じた特許協力案に注力するつもりである」と述べた。

出願動向

LED照明用放熱印刷回路基板の特許増加

有機発光ダイオード(OLED: Organic Light Emitting Diodes)照明の中核部品である放熱印刷回路基板(PCB)関連の技術開発が活発である。

特許庁は8月27日、2008年から2012年まで計152件のLED照明用放熱PCBに関する特許出願が行われたことを明らかにした。

放熱PCBは、LEDから発生する熱を効果的に放出し、LED照明の寿命と効率を高める機能をする主要な部品である。

年度別では、2008年19件、2009年38件、2010年40件、2011年55件と毎年増加し続けている。

最近出願されている放熱PCB技術は、単純に熱がよく伝達する材料を選択していた方式から離れて、LED照明の構造を改善する方式に発展している。

実際、過去4年間に提出された技術別では、印刷回路基板の放熱ホール、リードフレーム、積層方式等、構造や形状改善の技術が全体の67%と殆どを占めている。セラミック、金属、ナノ素子等新素材に関する技術も31%に上った。

出願人別では、個人を含む韓国内の中小企業が出願量の59%を占め、技術開発に積極的に乗り出していることが分かった。

これは、LED照明分野に対する中小企業の関心が高い上に、2011年に韓国政府がLEDを中小企業に適した業種に選定する等、LED照明産業が中小企業に合う業種として認識されている結果であると把握される。

電子審査課のカン・ヘソン課長は、「LED照明が広く普及すればするほど、放熱印刷回路基板の使用に関する技術開発及び特許出願は続いていくであろう」と述べた。

リチウム二次電子の特許動向

リチウム二次電池は、1991年に初めて市場に出てから、携帯用電子機器(IT)の移動用電源として毎年10%以上の成長を記録しており、xEVと呼ばれる次世代電気自動車(HEV、PHEV、EV)及びスマートグリッドに用いられるエネルギー貯蔵システム(ESS、Energy Storage System)産業を活性化させることが期待される中、リチウム二次電池はこのような次世代技術を具現するための中核部品で、その市場はますます拡大している。

特許庁の資料によると、最近10年間のリチウム二次電池に関する韓国出願件数は6,318件であり、このうち韓国出願人は4,400件と69.6%を占め、残りの1,918件(30.4%)は外国の出願人が出願したもので、最近10年間年平均10.2%の増加率で出願されていることが把握されている。

細部的な技術分野別出願比率を見ると、リチウム二次電池で最も多くの材料費を占めている陽極に関する技術が2,141件(33.9%)と最も高く、陰極は19.1%、電解質14.2%、分離膜12.3%を占めており、電池製造技術の分野も14.8%を占めている。

韓国出願件の多出願企業を見ると、LG化学、サムスンSIDの順で、45.5%以上を占めており、その後ろにパナソニック/三洋(合併)、ソニー、トヨタが続く。特に、リチウム二次電池の中核素材部品を生産する韓国の中小的素材企業(韓国電池産業協会の全員23社)は3.0%を占めており(企業当たり0.7件/年出願)、相対的に韓国の中小的素材企業のIP(知的財産)に対する競争力が非常に弱いと分析されている。

これまで韓国のリチウム二次電池産業は、日本に追いつくため努力し、日本の市場支配力を弱体化させてきたが、今後は豊富な安価の原材料を基に急速に成長している中国企業との競争が深化するであろうと予想される。特に、中小的素材企業の技術水準が向上すれば、完製品電池の競争力も高くなり得るため、中小企業の研究開発支援のための政府及び大企業の関心と投資が必要である。

電子・半導体

第一毛織、サムスンエバーランドにファッション事業を譲渡

第一毛織はファッション事業をサムスンエバーランドに譲渡し、素材専門企業に変身する。イ・ゴンヒ会長が昨年から強調してきたように、グループ内の素材事業の力を育てるためのものと解釈される。

同社は9月23日に理事会を開き、ファッション事業をサムスンエバーランドに1兆500億ウォンで譲渡することを明らかにした。

これによって、1954年から59年間「第一毛織」のシンボルであった織物とファッション事業は終結することになった。

第一毛織は株主総会等を経て、12月1日付でファッション事業の資産と人材を全て移管する予定である。創立60周年を迎える来年から、現在力を注いでいる新事業の素材事業にのみ集中することになる。

第一毛織は、1990年代に素材事業に進出し、織物事業中心から1980年代にはファッション事業、1990年代にはケミカル事業に進出した。2000年からは電子材料事業を新成長動力として育成してきた。ケミカルと電子材料事業を合わせた素材事業の売り上げは、すでに全体の70%に達している。特に、サムスン電子及び電子系列会社に供給する電子材料事業は最近急速に成長している。

第一毛織のファッション事業譲渡は、素材事業の強化のための財源を設けるとともに、グループ内の素材事業を集中して育成するための措置と解釈される。同社は、譲渡を通じて確保した1兆ウォン余りを電子材料をはじめとした素材事業の財源として活用する計画である。

また、異質的なファッション事業を取り除くことによって、サムスンの代表素材専門企業に変身できることになる。

サムスンは、これまでグループ全体の動力を活用して、素材事業を育成してきた。イ・ゴンヒ会長は、昨年末サムスンの系列会社の社長に、素材事業の競争力強化に力を入れるよう指示した。第一毛織がグローバルの超一流素材企業を目標に攻撃的に事業を始めた時期とかみ合う。人材を迎え入れることに拍車をかける一方、今年8月にはサムスン電子と共に有機発光ダイオード(OLED)の基幹技術メーカーであるドイツのNovaledを買収した。

これに伴って、サムスングループの素材事業においてシンクタンクの役割をする電子素材研究所も、第一毛織が主導する可能性が大きくなった。入居を始めた電子素材研究所は、年内に本格的な稼動に入るであろうと予想される。

第一毛織のパク・ジョンウ社長は、「今回のファッション事業譲渡の決定は、グローバル素材企業に生まれるために中核事業に集中するという意志の表現である」とし、「攻撃的な投資を通じ、次世代素材の研究開発と生産技術のシナジーを画期的に高め、主導企業になるきっかけになるであろう」と述べた。

サムスン電子、次世代CMOSイメージセンサのISOCELL開発

サムスン電子は、次世代CMOSイメージセンサ技術「ISOCELL」の開発に成功した。

ISOCELLは、CMOSイメージセンサの画素に集まった光を最大限活用できるようにセンサの構造を革新的に変化させた技術である。次世代の技術確保に成功したサムスン電子のシステムLSI事業部が高画素のCMOSイメージセンサ市場を占めているソニーの牙城を越えられるか注目されている。

同社システムLSI事業部は、ISOCELL技術を適用した4分の1インチ800万画素のCMOSイメージセンサ(製品名S5K4H5YB)を年内に量産すると明らかにした。

この製品は、CMOSイメージセンサの画素間に絶縁部を形成して隔離させ、干渉現象を最小化した。CMOSイメージセンサは、画素に集まった光の量に直接的な影響を受ける。最近のスマート機器は軽薄短小化で、CMOSイメージセンサのサイズが小さくなった反面、画素数は増えている。CMOSイメージセンサが十分な光を吸収しにくい理由である。

ISOCELL技術は、既存の製品より光の損失を減らすことができる。既存の後面照射(BSI)型CMOSイメージセンサより光を受け入れる面積が30%程増える。暗い環境でも、より鮮明なイメージを具現する。

既存の製品より干渉現象が30%以上減り、色再現性がよく、センサの厚みを減らしても十分な光を確保することができる。同事業部は1月、ISOCELL技術の特許を出願し、競争社が類似製品を作ることができないようにした。

サムスン電子は、モバイルCMOSイメージセンサの市場で、5年連続1位を守っている。次世代COMSイメージセンサのISOCELL技術を確保したことによって、今後の市場主導権をさらに強化するであろうと予想される。

システムLSIマーケティングチームのキム・テフン常務は、「ISOCELLは既存のCMOSイメージセンサの限界を克服した革新的な技術である」とし、「技術をさらに高度化し、CMOSイメージセンサ市場の占有率を拡大していくつもりである」と述べた。

化学・金属・生命工学

した同種組織を筋骨格系患者を治療するための移植材として開発し、病院及び代理店に供給している。

Cellumed、同種軟組織移植材の培養装置の特許取得

Cellumed(代表シン・ヨンボク)は9月27日、同種軟組織移植材の培養装置(出願番号10-2012-0018649)に対する韓国特許を取得したことを明らかにした。

今回の特許は、十字靭帯再建術に用いられる同種軟組織移植材の強度を向上させる培養装置に関するもので、この培養器は、膝運動の際に組織に加えられる刺激と類似する刺激を移植材に伝達することによって、組織本来の強度を向上させることができるようにした。

現在前十字靭帯や後十字靭帯の破裂患者には、同種軟組織を移植材として使用しているが、移植直後に物理的強度が急激に低下し、再手術の比率が高いのが実情である。

しかし、今回Cellumedが特許を受けた同種軟組織移植材の培養装置を用いた組織は、このようなデメリットを大きく改善するであろうと予想され、韓国国内で約1千億ウォン、海外では約7千億ウォン規模の十字靭帯再建術市場に有用に使用されるであろうと期待される。

同社のシン・ヨンボク代表は、「今回の特許取得を通じ、当社は軟組織移植材の強度を向上させることができる技術の検証を受けることになった」とし、「今後、同種軟組織だけでなく、異種組織移植材の開発にも該当技術を積極的に活用し、多様で優れた先端移植材を開発する計画である」と述べた。

一方、Cellumedは、組織銀行事業を通じ、ドナーから採取

韓国における知的財産問題でお悩みですか 新しい選択、HA&HAにお任せ下さい。

(調査、特許・実用新案・デザイン・商標の出願及び登録、著作権、電子商取引、インターネット上の権利、コンピュータプログラム、侵害訴訟及び各種紛争)

河 合同特許法律事務所

ソウル市瑞草区Juheung 3-Gil 1 栄和B/D(盤浦洞)
Tel : +82-2-548-1609
Fax : +82-2-548-9555, 511-3405
E-mail : haandha@haandha.co.kr
Website : <http://haandha.co.kr>

SEOUL TECHNO R&C CO., LTD.

ソウル市瑞草区Juheung 3-Gil 1 栄和B/D(盤浦洞)
Tel : +82-2-3443-8434
Fax : +82-2-3443-8436
E-mail : st@stpat.co.kr